

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-234042

(43)Date of publication of application : 20.08.2002

---

(51)Int.Cl. B29C 41/28  
B29C 41/32  
B29C 41/38  
C08J 5/18  
// B29K 1:00  
B29L 7:00  
B29L 9:00  
C08L 1:12

---

(21)Application number : 2001-031765

(71)Applicant : FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing : 08.02.2001

(72)Inventor : FUJII SHOSUKE  
TAKAHASHI KOJI  
TSUJIMOTO TADAHIRO

---

(54) METHOD FOR FORMING FILM USING DOPE

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for forming a film using a dope by which the film with outstanding smoothness and transparency and also high thickness precision can be formed.

SOLUTION: In the method for forming the film by casting a dope over a casting band from a casting die, the casting band is used which has a central line average roughness of 0.005  $\mu$ m or less and a difference of 0.06 mm or less between a thickness at the thickest spot and a thickness at the thinnest spot.

---

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-234042

(P2002-234042A)

(43) 公開日 平成14年8月20日 (2002.8.20)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード* (参考)
B 2 9 C 41/28		B 2 9 C 41/28	4 F 0 7 1
41/32		41/32	4 F 2 0 2
41/38		41/38	4 F 2 0 5
C 0 8 J 5/18	C E P	C 0 8 J 5/18	C E P
// B 2 9 K 1:00		B 2 9 K 1:00	
審査請求 未請求 請求項の数14 O L (全 11 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号	特願2001-31765(P2001-31765)	(71) 出願人	000005201 富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地
(22) 出願日	平成13年2月8日 (2001.2.8)	(72) 発明者	藤井 正輔 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内
		(72) 発明者	高橋 公司 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真 フイルム株式会社内
		(74) 代理人	100085109 弁理士 田中 政浩
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 溶液製膜方法

(57) 【要約】

【課題】 平滑性及び透明性が良好で、また、厚み精度が良好なフィルムを製造することができる溶液性膜方法を提供することを目的とする。

【解決手段】 流延ダイより流延バンド上にドープを流延してフィルムを製造する方法において、中心線平均粗さが0.005  $\mu$ m以下であり、かつ、最も厚い個所の厚みと最も薄い個所の厚みとの差が0.06 mm以下である流延バンドを用いた。

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 流延ダイより流延バンド上にドーブを流延してフィルムを製造する方法において、中心線平均粗さが0.005 $\mu$ m以下である流延バンドを用いたことを特徴とする溶液製膜方法。

【請求項2】 流延ダイより流延バンド上にドーブを流延してフィルムを製造する方法において、最も厚い個所の厚みと最も薄い個所の厚みとの差が0.06mm以下である流延バンドを用いたことを特徴とする溶液製膜方法。

【請求項3】 流延ダイより流延バンド上にドーブを流延してフィルムを製造する方法において、流延バンド1回転分の製品フィルムの任意の2点の厚み差が4 $\mu$ m以下であることを特徴とする溶液製膜方法。

【請求項4】 中心線平均粗さが0.001 $\mu$ m以上である流延バンドを用いた請求項1記載の溶液製膜方法。

【請求項5】 前記流延バンドの1回転でのバンド位置の巾方向変位が3mm以下であることを特徴とする請求項1、2、3又は4記載の溶液製膜方法。

【請求項6】 前記ドーブが、セルローストリアセートであることを特徴とする請求項1、2、3、4又は5記載の溶液製膜方法。

【請求項7】 前記流延ダイより流延バンド上にドーブを流延する際、2種類以上のセルロースアシレート溶液からなるドーブを共流延することを特徴とする請求項1、2、3、4又は5記載の溶液製膜方法。

【請求項8】 前記ドーブがセルロースアシレート溶液であって、その溶媒が酢酸メチル、ケトン類及びアルコールからなり、その溶媒比率が酢酸メチルが20～90質量%、ケトン類が5～60質量%、アルコールが5～30質量%である請求項1、2、3、4、5又は7記載の溶液製膜方法。

【請求項9】 前記ドーブがセルロースアシレート溶液であり、かつ、少なくとも一種の可塑剤をセルロースアシレートに対して0.1～20質量%含有していることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、7又は8記載の溶液製膜方法。

【請求項10】 前記ドーブがセルロースアシレート溶液であり、かつ、少なくとも一種の紫外線吸収剤をセルロースアシレートに対して0.001～5質量%含有していることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、7、8又は9記載の溶液製膜方法。

【請求項11】 前記ドーブがセルロースアシレート溶液であり、かつ、少なくとも一種の微粒子粉体をセルロースアシレートに対して0.001～5質量%含有していることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、7、8、9又は10記載の溶液製膜方法。

【請求項12】 前記ドーブがセルロースアシレート溶液であり、かつ、少なくとも一種の離型剤をセルロースアシレートに対して0.001～2質量%含有している

ことを特徴とする請求項1、2、3、4、5、7、8、9、10又は11記載の溶液製膜方法。

【請求項13】 前記ドーブがセルロースアシレート溶液であり、かつ、少なくとも一種のフッ素系界面活性剤をセルロースアシレートに対して0.002～2質量%含有していることを特徴とする請求項1、2、3、4、5、7、8、9、10、11又は12記載の溶液製膜方法。

【請求項14】 前記請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12又は13記載の溶液製膜方法で製造されたフィルムからなる偏光板用保護膜。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、厚み精度が良好で、平滑性、透明性が良好なフィルムを製造することができる溶液製膜方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】液晶表示装置に用いられる偏光板の偏光板保護膜としては、透明性がよく、機械的強度が大きく、温度の変化及び熱にともなう寸法変動が小さい（寸法安定性がよい）ので、セルロースエステルフィルムが用いられている。このセルロースエステルフィルムは、溶液製膜方法で製造されており、例えば、図1に示すような製膜装置で製造されている。

【0003】図1において、10はドーブを支持体上に流延する流延工程、20は流延工程10で形成されたフィルムをテンターで延伸する延伸乾燥工程、30は延伸されたフィルムを乾燥させる乾燥工程である。流延工程10は、流延ダイ11が設けられており、この流延ダイ11から下方に設けられた流延バンド12に、セルロースエステルを溶媒に溶解したドーブが流延される。延伸乾燥工程20は、テンター21が設けられフィルムを巾方向に延伸させるとともに乾燥させるようになっている。乾燥工程30は、搬送ロール31が設けられ、乾燥風32により搬送ロール31で搬送中のフィルムを乾燥させるものである。40は完成したフィルムを巻き取る巻取り部である。

【0004】そして、前記流延バンド12の表面は、フィルム表面の平滑性、フィルムの透明性を確保するために、鏡面仕上げがなされている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の流延バンドを用いた溶液製膜方法で製造されたフィルムは、平滑性及び透明性が十分でない場合があり、より改良されることが要望されていた。また、フィルムの厚み精度が十分でない場合があった。

【0006】本発明は以上の問題点を解決し、平滑性及び透明性が良好で、また、厚み精度が良好なフィルムを製造することができる溶液製膜方法を提供することを目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明者は、上述した目的を達成するために、流延バンドの鏡面性、すなわち中心平均粗さと平滑性及び透明性に関して鋭意研究し、良好な平滑性及び透明性を得ることができる中心線平均粗さの範囲を見出した。

【0008】また、本発明者は、フィルムの厚み精度が悪くなる原因について鋭意研究し、その原因を見出した。すなわち、流延バンドは、全体が均一な厚みではなく、厚い個所と薄い個所が存在するものであり、このように流延バンドに厚みの差があると、流延ダイと流延バンドとのクリアランスが変動し、このクリアランスの変動がフィルムの厚み精度に悪影響を与えるものであることを見出した。そして、さらに鋭意研究し、流延バンドの最も厚い個所の厚みと最も薄い個所の厚みとの差を所定の範囲内にすることにより、フィルムの厚み精度を確保できることを見出し、本発明を完成させたものである。

【0009】また、フィルムの厚み差が引き起こす搬送工程等におけるシワや巻ズレ、又は貼合ムラと、厚み差との関係について検討し、厚み差の許容範囲を見出し本発明を完成させたものである。

【0010】本発明は、以上の知見に基づきなされたもので、フィルム表面の平滑性及びフィルムの透明性を確保するために一定以上の超鏡面仕上げの流延バンドを使用するとともに、フィルムの厚み精度を確保するために、一定範囲内の厚み精度を持つ流延バンドを使用するものである。

【0011】すなわち、本発明による溶液製膜方法は、流延ダイより流延バンド上にドープを流延してフィルムを製造する方法において、中心線平均粗さが $0.001\mu\text{m}$ 以上かつ $0.005\mu\text{m}$ 以下である流延バンドを用いたことを特徴として構成されている。

【0012】また、本発明による溶液製膜方法は、流延ダイより流延バンド上にドープを流延してフィルムを製造する方法において、最も厚い個所の厚みと最も薄い個所の厚みとの差が $0.06\text{mm}$ 以下である流延バンドを用いたことを特徴として構成されている。

【0013】さらに、本発明による溶液製膜方法は、流延ダイより流延バンド上にドープを流延してフィルムを製造する方法において、流延バンド1回転分の製品フィルムの任意の2点の厚み差が $4\mu\text{m}$ 以下であることを特徴として構成されている。

【0014】

【発明の実施の形態】本発明においては、中心線平均粗さ(Ra)が以上かつ $0.005\mu\text{m}$ 以下の流延バンドを使用し、好ましくは $0.003\mu\text{m}$ 以下であり、また、 $0.001\mu\text{m}$ 以上であることが好ましい。中心線平均粗さ(Ra)が $0.005\mu\text{m}$ を超えると、製造したフィルム表面の平滑性及びフィルムの透明性を良好に

することができない。

【0015】流延バンドの表面の中心線平均粗さ(Ra)が $0.005\mu\text{m}$ 以下の超鏡面仕上げとするには、例えば、ベルンドルフ社「C polish」を用いて研磨する。

【0016】本発明においては、最も厚い個所の厚みと最も薄い個所の厚みとの差(以下、「流延バンド厚み差」という)が $0.06\text{mm}$ 以下の流延バンドを使用し、好ましくは $0.05\text{mm}$ 以下、より好ましくは $0.02\text{mm}$ 以下の流延バンドを使用する。流延バンド厚み差が $0.06\text{mm}$ を超えると、流延ダイと流延バンドとのクリアランスの変動が大きく、製造されたフィルムの厚み精度が悪くなる。

【0017】例えば、図2に示す流延バンドの部分断面図において、流延バンド12は長手方向(図中、左右方向)に厚みが異なっており、この異なる厚みの中で最も厚い個所aの厚み $t_{\text{max}}$ と、最も薄い個所bの厚み $t_{\text{min}}$ との厚み差 $t(t_{\text{max}} - t_{\text{min}})$ が $0.06\text{mm}$ 以下である。なお、この例では、説明のため長手方向に一部について最も厚い個所と最も薄い個所を採用しているが、本発明においては、長手方向に全域及び巾方向の全域において最も厚い個所と最も薄い個所を採用するものである。

【0018】流延バンドは、狭幅バンド( $1500\text{mm}$ 未満)と広幅バンド( $1500\text{mm}$ 以上、 $2000\text{mm}$ 未満)とがあり、狭幅バンドの場合は、厚み $t(\text{mm})$ が、 $1 - 0.065 \leq t \leq 1 + 0.065$ であることが好ましく、広幅バンドの場合は、厚み $t(\text{mm})$ が、 $1.6 - 0.15 \leq t \leq 1.6 + 0.05$ であることが好ましい。

【0019】また、流延バンド1回転での流延バンド位置の巾方向変位が $3\text{mm}$ 以下であることが好ましく、 $1.5\text{mm}$ 以下であることがより好ましい。流延バンドの巾方向の変位が大きいと、流延バンドが蛇行した際、流延エッジ部の位置が変化して流延バンド面への剥き残りや、汚れの付着を引き起こすことがあり、これらの汚れが成長すると、剥離不良となり、安定流延ができなくなることがある。

【0020】また、本発明の溶液製膜方法においては、流延バンド1回転分の製品フィルムの任意の2点の厚み差が $4\mu\text{m}$ 以下であることを要し、好ましくは $2\mu\text{m}$ 以下である。厚み差が $4\mu\text{m}$ を超えると、フィルムの搬送工程や巻取り工程で、シワや巻ズレが生ずることがある。また、偏光板加工時の貼合ムラにより偏光板の性能が低下したり、ハードコート、反射防止膜、光学機能性膜等の塗工の際、塗工ムラが生ずることがある。

【0021】本発明の溶液製膜方法に用いるドープの素材ポリマーとしては、セルロースアシレートが用いられる。セルロースアシレートの詳細について、以下に記載する。好ましいセルロースアシレートは、セルロース

の水酸基への置換度が下記式①～④の全てを満足するものである。

$$\textcircled{1} \quad 2.6 \leq A+B \leq 3.0$$

$$\textcircled{2} \quad 2.0 \leq A \leq 3.0$$

$$\textcircled{3} \quad 0 \leq B \leq 0.8$$

$$\textcircled{4} \quad 1.9 < A-B$$

【0022】ここで、式中A及びBはセルロースの水酸基に置換されているアシル基の置換基を表し、Aはアセチル基の置換度、またBは炭素原子数3～5のアシル基の置換度である。セルロースには1グルコース単位に3個の水酸基があり、上記の数字はその水酸基3.0に対する置換度を表すもので、最大の置換度が3.0である。セルローストリアセテートは一般にAの置換度が2.6以上3.0以下であり（この場合、置換されなかった水酸基が最大0.4もある）、B=0の場合がセルローストリアセテートである。本発明の溶液製膜方法のドープに用いるセルロースアシレートは、アシル基が全部アセチル基のセルローストリアセテート、及びアセチル基が2.0以上で、炭素原子数が3～5のアシル基が0.8以下、置換されなかった水酸基が0.4以下のものが好ましく、置換度2.6～3.0のセルローストリアセテートが特に好ましい。なお、置換度は、セルロースの水酸基に置換する酢酸及び炭素原子数3～5の脂肪酸の結合度を測定し、計算によって得られる。測定方法としては、ASTMのD-817-91に準じて実施することが出来る。

【0023】アセチル基の他の炭素原子数3～5のアシル基はプロピオニル基( $C_2H_5CO-$ )、ブチリル基( $C_3H_7CO-$ ) (n-, iso-)、バネリル基( $C_4H_9CO-$ ) (n-, iso-, sec-, tert-)で、これらのうちn-置換のものがフィルムにした時の機械的強さ、溶解し易さ等から好ましく、特にn-プロピオニル基が好ましい。また、アセチル基の置換度が低いと機械的強さ、耐湿熱性が低下する。炭素原子数3～5のアシル基の置換度が高いと有機溶媒への溶解性は向上するが、それぞれの置換度が前記の範囲であれば良好な物性を示す。

【0024】セルロースアシレートの重合度（粘度平均）は200～700が好ましく、特に250～550のものが好ましい。粘度平均重合度（DP）は、オストワルド粘度計で求めることができ、測定されたセルロースアシレートの固有粘度 $[\eta]$ から下記式により求められる。

$$DP = [\eta] / K_m \text{ (式中、} K_m \text{は定数} 6 \times 10^{-4} \text{)}$$

【0025】セルロースアシレート原料のセルロースとしては、綿花リンターや木材パルプなどがあるが、何れの原料セルロースから得られるセルロースアシレートでも使用でき、また、これらを混合して使用してもよい。

【0026】セルロースアシレートを溶解する有機溶媒の例には、炭化水素（例：ベンゼン、トルエン）、ハロ

ゲン化炭化水素（例：メチレンクロライド、クロロベンゼン）、アルコール（例：メタノール、エタノール、ジエチレングリコール）、ケトン（例：アセトン）、エステル（例：酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル）及びエーテル（例：テトラヒドロフラン、メチルセロソルブ）などがあげられる。

【0027】炭素原子数1～7のハロゲン化炭化水素が好ましく用いられ、メチレンクロライドが最も好ましく用いられる。セルロースアシレートの溶解性、支持体からの剥き取り性、フィルムの機械強度等、光学特性等の物性の観点から、メチレンクロライドの他に炭素原子数1～5のアルコールを一種、ないし数種類混合することが好ましい。アルコールの含有量は、溶媒全体に対し2～25質量%が好ましく、5～20質量%がより好ましい。アルコールの具体例としては、メタノール、エタノール、n-プロパノール、イソプロパノール、n-ブタノール等があげられるが、メタノール、エタノール、n-ブタノール、あるいはこれらの混合物が好ましく用いられる。

【0028】また、酢酸メチル、ケトン類及びアルコールからなり、その溶媒比率が酢酸メチルが20～90質量%、ケトン類が5～60質量%、アルコールが5～30質量%である溶媒を用いることが好ましい。

【0029】最近、環境に対する影響を最小限に抑えるため、メチレンクロライドを用いない溶媒組成も提案されている。この目的に対しては、炭素原子数が3～12のエーテル、炭素原子数が3～12のケトン、炭素原子数が3～12のエステルが好ましく、これらを適宜混合して用いる。これらのエーテル、ケトン及びエステルは、環状構造を有していてもよい。エーテル、ケトン及びエステルの官能基（すなわち、 $-O-$ 、 $-CO-$ 及び $-COO-$ ）のいずれかを二つ以上有する化合物も、有機溶媒として用いることができる。有機溶媒は、アルコール性水酸基のような他の官能基を有していてもよい。二種類以上の官能基を有する有機溶媒の場合、その炭素原子数は、いずれかの官能基を有する化合物の規定範囲内であればよい。

【0030】炭素原子数が3～12のエーテル類の例には、ジイソプロピルエーテル、ジメトキシメタン、ジメトキシエタン、1,4-ジオキサン、1,3-ジオキソラン、テトラヒドロフラン、アニソール及びフェネトールがあげられる。炭素原子数が3～12のケトン類の例には、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、ジイソブチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン及びメチルシクロヘキサノンがあげられる。炭素原子数が3～12のエステル類の例には、エチルホルメート、プロピルホルメート、ベンチルホルメート、メチルアセテート、エチルアセテート及びベンチルアセテートがあげられる。二種類以上の官能基を有する有機溶媒の例には、2-エトキシエチルアセテート、2-メト

キシエタノール及び2-ブトキシエタノールがあげられる。

【0031】本発明の溶液製膜方法に用いるドーブには、各調製工程において用途に応じた種々の添加剤（例えば、可塑剤、紫外線吸収剤、劣化防止剤、微粒子粉体、離型剤、光学特性調整剤、フッ素系界面活性剤）を加えることができる。またその添加する時期はドーブ作製工程において何れでも添加しても良いが、ドーブ調製工程の最後の調製工程に添加剤を添加し調製する工程を加えて行ってもよい。

【0032】前記可塑剤としては、リン酸エステル又はカルボン酸エステルが用いられる。リン酸エステルの例には、トリフェニルフォスフェート（TPP）及びトリクレジルフォスフェート（TCP）、クレジルジフェニルフォスフェート、オクチルジフェニルフォスフェート、ジフェニルビフェニルフォスフェート、トリオクチルフォスフェート、トリブチルフォスフェート等があげられる。カルボン酸エステルとしては、フタル酸エステル及びクエン酸エステルが代表的である。フタル酸エステルの例には、ジメチルフタレート（DMP）、ジエチルフタレート（DEP）、ジブチルフタレート（DBP）、ジオクチルフタレート（DOP）、ジフェニルフタレート（DPP）及びジエチルヘキシルフタレート（DEHP）が含まれる。クエン酸エステルの例には、O-アセチルクエン酸トリエチル（OACTE）及びO-アセチルクエン酸トリブチル（OACTB）、クエン酸アセチルトリエチル、クエン酸アセチルトリブチルが含まれる。

【0033】その他のカルボン酸エステルの例には、オレイン酸ブチル、リシノール酸メチルアセチル、セバシン酸ジブチル、トリメチルトリメリテート等のトリメリット酸エステルが含まれる。グリコール酸エステルの例としては、トリアセチン、トリブチリン、ブチルフタリルブチルグリコレート、エチルフタリルエチルグリコレート、メチルフタリルエチルグリコレート、ブチルフタリルブチルグリコレートなどがある。

【0034】以上に例示した可塑剤の中でも、トリフェニルフォスフェート、ビフェニルジフェニルフォスフェート、トリクレジルフォスフェート、クレジルジフェニルフォスフェート、トリブチルフォスフェート、ジメチルフタレート、ジエチルフタレート、ジブチルフタレート、ジオクチルフタレート、ジエチルヘキシルフタレート、トリアセチン、エチルフタリルエチルグリコレート、トリメチルトリメリテートらを用いることが好ましい。特にトリフェニルフォスフェート、ビフェニルジフェニルフォスフェート、ジエチルフタレート、エチルフタリルエチルグリコレート、トリメチルトリメリテートが好ましい。

【0035】以上のような可塑剤は1種でもよいし2種以上併用してもよい。可塑剤の添加量は、セルロースア

シレートに対して0.1～20質量%が好ましく、5～15質量%がより好ましい。添加量が0.1質量%未満では添加効果を十分に発揮することができず、添加量が20質量%を超えると、フィルム表面にブリードアウトする場合がある。

【0036】その他、本発明においてはその光学的異方性を小さくする可塑剤として、特開平11-124445号記載の（ジ）ペンタエリスリトールエステル類、特開平11-246704号記載のグリセロールエステル類、特開2000-63560号記載のジグリセロールエステル類、特開平11-92574号記載のクエン酸エステル類、特開平11-90946号記載の置換フェニルリン酸エステル類などが好ましく用いられる。

【0037】前記紫外線吸収剤は、目的に応じ任意の種類のものを選択することができ、サリチル酸エステル系、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、ベンゾエート系、シアノアクリレート系、ニッケル錯塩系等の吸収剤を用いることができるが、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系、サリチル酸エステル系が好まし

い。ベンゾフェノン系紫外線吸収剤の例として、2,4-ジヒドロキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-アセトキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン、2,2'-ジ-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン、2,2'-ジ-ヒドロキシ-4,4'-メトキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-n-オクトキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-ドデシルオキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-(2-ヒドロキシ-3-メタクリロキシ)プロポキシベンゾフェノン等をあげることができる。ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤としては、2(2'-ヒドロキシ-3'-tert-ブチル-5'-メチルフェニル)-5-クロルベンゾトリアゾール、2(2'-ヒドロキシ-5'-tert-ブチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ-tert-アミルフェニル)ベンゾトリアゾール、2(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ-tert-ブチルフェニル)-5-クロルベンゾトリアゾール、2(2'-ヒドロキシ-5'-tert-オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール等をあげることができる。サリチル酸エステル系としては、フェニルサリシレート、p-オクチルフェニルサリシレート、p-tert-ブチルフェニルサリシレート等をあげることができる。これら例示した紫外線吸収剤の中でも、特に2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン、2,2'-ジ-ヒドロキシ-4,4'-メトキシベンゾフェノン、2(2'-ヒドロキシ-3'-tert-ブチル-5'-メチルフェニル)-5-クロルベンゾトリアゾール、2(2'-ヒドロキシ-5'-tert-ブチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ-tert-アミルフェニル)ベンゾトリアゾール、2(2'-ヒ

ドロキシ-3', 5'-ジ-tert-ブチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾールが特に好ましい。

【0038】紫外線吸収剤は、吸収波長の異なる複数の吸収剤を複合して用いることが、広い波長範囲で高い遮断効果を得ることができるので好ましい。液晶用紫外線吸収剤は、液晶の劣化防止の観点から、波長370nm以下の紫外線の吸収能に優れ、かつ、液晶表示性の観点から、波長400nm以上の可視光の吸収が少ないものが好ましい。例えば、オキシベンゾフェノン系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物、サリチル酸エステル系化合物、ベンゾフェノン系化合物、シアノアクリレート系化合物、ニッケル錯塩系化合物などが挙げられる。特に好ましい紫外線吸収剤は、ベンゾトリアゾール系化合物やベンゾフェノン系化合物である。中でも、ベンゾトリアゾール系化合物は、セルロースエステルに対する不要な着色が少ないことから、好ましい。

【0039】また、紫外線吸収剤については、特開昭60-235852号、特開平3-199201号、同5-1907073号、同5-194789号、同5-271471号、同6-107854号、同6-118233号、同6-148430号、同7-11056号、同7-11055号、同7-11056号、同8-29619号、同8-239509号、特開2000-204173号の各公報に記載がある。

【0040】紫外線吸収剤の添加量は、セルロースアシレートに対し0.001~5質量%が好ましく、0.01~1質量%がより好ましい。添加量が0.001質量%未満では添加効果を十分に発揮することができず、添加量が5質量%を超えると、フィルム表面へ紫外線吸収剤がブリードアウトする場合がある。

【0041】また、紫外線吸収剤はセルロースアシレート溶解時に同時に添加しても良いし、溶解後のドープに添加しても良い。特にスタティックミキサ等を用い、流延直前にドープに紫外線吸収剤溶液を添加する形態が、分光吸収特性を容易に調整することができ、好ましい。

【0042】前記微粒子粉体としては、シリカ、カオリン、タルク、ケイソウ土、石英、炭酸カルシウム、硫酸バリウム、酸化チタン、アルミナなどを目的に応じ、任意に用いることができる。これら微粒子粉体はドープに添加する前に、高速ミキサー、ボールミル、アトライター、超音波分散機等、任意の手段でバインダー溶液中に分散を行うことが好ましい。バインダーとしてはセルロースアシレートが好ましい。紫外線吸収剤等、他の添加物と共に分散を行うことも好ましい。分散溶媒は任意であるが、ドープ溶媒と近い組成であることが好ましい。

【0043】微粒子粉体の数平均粒径は0.01~100μmが好ましく、0.1~10μmが特に好ましい。上記の分散液はセルロースアシレート溶解工程に同時に添加しても良いし、任意の工程でドープに添加できるが、紫外線吸収剤同様スタティックミキサ等を用い、流

延直前に添加する形態が好ましい。

【0044】微粒子粉体の含有量は、セルロースアシレートに対して0.001~5質量%であることが好ましく、0.01~1質量%であることがより好ましい。添加量が0.001質量%未満では添加効果を十分に発揮することができず、添加量が5質量%を超えると、外観面状が悪くなる場合がある。

【0045】前記離型剤としては、界面活性剤が有効であり、リン酸系、スルホン酸系、カルボン酸系、ノニオン系、カチオン系など特に限定されない。これらは、例えば特開昭61-243837号などに記載されている。離型剤の添加量は、セルロースアシレートに対して0.001~2質量%が好ましく、0.01~1質量%がより好ましい。添加量が0.001質量%未満であれば添加効果を十分に発揮することができず、添加量が2質量%を超えると、析出したり、不溶解物を生じたりすることがある。

【0046】ノニオン系界面活性剤としては、ポリオキシエチレン、ポリオキシプロピレン、ポリオキシブチレン、ポリグリシジルやソルビタンをノニオン性親水性基とする界面活性剤であり、具体的には、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン-ポリオキシプロピレングリコール、多価アルコール脂肪酸部分エステル、ポリオキシエチレン多価アルコール脂肪酸部分エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、脂肪酸ジエタノールアミド、トリエタノールアミン脂肪酸部分エステルを挙げることができる。

【0047】アニオン系界面活性剤としてはカルボン酸塩、硫酸塩、スルホン酸塩、リン酸エステル塩であり、代表的なものとしては脂肪酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩、アルキルスルホン酸塩、α-オレフィンスルホン酸塩、ジアルキルスルフォコハク酸塩、α-スルホン化脂肪酸塩、N-メチル-Nオレイルタウリン、石油スルホン酸塩、アルキル硫酸塩、硫酸化油脂、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンスチレン化フェニルエーテル硫酸塩、アルキルリン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸塩、ナフタレンスルホン酸塩ホルムアルデヒド縮合物などである。

【0048】カチオン系界面活性剤としてはアミン塩、4級アンモニウム塩、ビリジウム塩などを挙げることができ、第一~第3脂肪アミン塩、第4級アンモニウム塩（テトラアルキルアンモニウム塩、トリアルキルベンジルアンモニウム塩、アルキルビリジウム塩、アルキルイミダゾリウム塩など）を挙げることが出来る。両性系界面活性剤としてはカルボキシベタイン、スルフォベタイン

ンなどであり、N-トリアルキル-N-カルボキシメチルアンモニウムベタイン、N-トリアルキル-N-スルフォアルキレンアンモニウムベタインなどである。

【0049】前記フッ素系界面活性剤を添加することにより、帯電防止効果を発揮することができる。フッ素系界面活性剤の添加量は、セルロースアシレートに対して0.002～2質量%が好ましく、0.01～0.5質量%がより好ましい。添加量が0.002質量%未満であれば添加効果を十分に発揮することができず、添加量が2質量%を超えると、析出したり、不溶解物を生じたりすることがある。

【0050】本発明においては、レターデーション上昇剤（光学特性調整剤）を添加することができる。レターデーション上昇剤を添加することにより、光学異方性をコントロールすることができる。レターデーション上昇剤は、セルロースアシレートフィルムのレターデーションを調整するため、少なくとも二つの芳香族環を有する芳香族化合物を使用することが好ましい。芳香族化合物は、セルロースアシレート100質量部に対して、0.01～20質量部の範囲で使用する。芳香族化合物は、セルロースアシレート100質量部に対して、0.05～15質量部の範囲で使用する。0.1～10質量部の範囲で使用する。二種類以上の芳香族化合物を併用してもよい。芳香族化合物の芳香族環には、芳香族炭化水素環に加えて、芳香族性ヘテロ環を含む。

【0051】芳香族炭化水素環は、6員環（すなわち、ベンゼン環）であることが特に好ましい。芳香族性ヘテロ環は一般に、不飽和ヘテロ環である。芳香族性ヘテロ環は、5員環、6員環または7員環であることが好ましく、5員環または6員環であることがさらに好ましい。芳香族性ヘテロ環は一般に、最多の二重結合を有する。ヘテロ原子としては、窒素原子、酸素原子および硫黄原子が好ましく、窒素原子が特に好ましい。芳香族性ヘテロ環の例には、フラン環、チオフェン環、ピロール環、オキサゾール環、イソオキサゾール環、チアゾール環、イソチアゾール環、イミダゾール環、ピラゾール環、フラザン環、トリアゾール環、ピラン環、ビリジン環、ピリダジン環、ピリミジン環、ピラジン環および1,3,5-トリアジン環が含まれる。

【0052】本発明においては、着色剤を添加することができる。着色剤を添加することにより、感光材料支持体等に用いる場合、ライトバイビングを防止することができる。着色剤の添加量は、セルロースアシレートに対する重量割合で10～1000ppmが好ましく、50～500ppmが更に好ましい。

【0053】また、本発明におけるドーブには、ルシウム、マグネシウムなどのアルカリ土類金属の塩などの熱安定剤、帯電防止剤、難燃剤、滑剤、油剤などを、必要に応じて適宜添加することができる。

【0054】本発明の溶液製膜方法で製造されるフィルムの光学特性について記す。まず、フィルムの面内のレターデーション（Re）について記すと、その測定法はエリブソメーター（偏光解析計AEP-100：島津製作所（株）製）を用いて、波長632.8nmにおける面内の縦横の屈折率差にフィルム膜厚さを乗じたものであり、下記の式で求められる。

$$Re = (n_x - n_y) \times d$$

$n_x$ ：横方向の屈折率

$n_y$ ：縦方向の屈折率

【0055】小さいほど、面内方向の光学異方性がないことを示すが0～300nmの範囲で用途に応じて用いられる。又、フィルムの厚さ方向のレターデーション（Rth）も重要であり、波長632.8nmにおける厚さ方向の複屈折にフィルム膜厚さを乗じたものであり、下記の式で求められる。

$$Rth = \{ (n_x + n_y) / 2 - n_z \} \times d$$

$n_x$ ：横方向の屈折率

$n_y$ ：縦方向の屈折率

$n_z$ ：厚さ方向の屈折率

【0056】厚さ方向の屈折率が小さいほど、厚さ方向の光学異方性がないことを示すが、その使用用途によって好ましい範囲は定まる。一般には、本発明のセルロースアシレートフィルムのRthは100μm当たり、0nm～600nmであり、さらには0nm～400nmで用いられる。

【0057】本発明による溶液製膜方法は、各種フィルムの製膜に適用することができ、例えば、光学補償シート、偏光板用保護膜、AR、LR、AG膜用支持体フィルム等の光学用途フィルム、写真感光材料用支持体フィルム等の製膜に適用することができ、特に、外観面状に高品質が要求される光学補償シート、偏光板用保護膜等に好適である。

【0058】本発明の溶液製膜方法で製造されたフィルムを光学補償シートとして用いる場合、フィルムそのものを光学補償シートとして用いることができる。なお、フィルムそのものを光学補償シートとして用いる場合は、偏光素子（後述）の透過軸と、フィルムからなる光学補償シートの遅相軸とを実質的に平行または垂直になるように配置することが好ましい。このような偏光素子と光学補償シートとの配置については、特開平10-48420号公報に記載がある。液晶表示装置は、二枚の電極基板の間に液晶を担持してなる液晶セル、その両側に配置された二枚の偏光素子、および該液晶セルと該偏光素子との間に少なくとも一枚の光学補償シートを配置した構成を有している。

【0059】また、支持体の上に液晶（特にディスコティック液晶性分子）を含む光学的異方性層を設けた光学補償シートも提案されている（特開平3-9325号、同6-148429号、同8-50206号、同9-2



6572号の各公報記載)。本発明の溶液製膜方法で製造されたセルロースアシレートフィルムは、そのような光学補償シートの支持体としても用いることができる。

【0060】光学的異方性層は、負の一軸性を有し傾斜配向したディスコティック液晶性分子を含む層であることが好ましい。ディスコティック液晶性分子の円盤面と支持体面とのなす角は、光学的異方性層の深さ方向において変化している（ハイブリッド配向している）ことが好ましい。ディスコティック液晶性分子の光軸は、円盤面の法線方向に存在する。ディスコティック液晶性分子は、光軸方向の屈折率よりも円盤面方向の屈折率が大きな複屈折性を有する。ディスコティック液晶性分子は、支持体表面に対して実質的に水平に配向させてもよい。

【0061】本発明の溶液製膜方法で製造されたセルロースアシレートフィルムは、VAモードの液晶セルを有するVA型液晶表示装置の光学補償シートの支持体として特に有利に用いられる。VA型液晶表示装置に用いる光学補償シートには、レターデーションの絶対値が最小となる方向が光学補償シートの面内にも法線方向にも存在しないことが好ましい。VA型液晶表示装置に用いる光学補償シートの光学的性質は、光学的異方性層の光学的性質、支持体の光学的性質および光学的異方性層と支持体との配置により決定される。VA型液晶表示装置に光学補償シートを二枚使用する場合は、光学補償シートの面内レターデーションを、 $-5\text{ nm} \sim 5\text{ nm}$ の範囲内にすることが好ましい。従って、二枚の光学補償シートのそれぞれの面内レターデーションの絶対値は、 $0 \sim 5$ とすることが好ましい。VA型液晶表示装置に光学補償シートを一枚使用する場合は、光学補償シートの面内レターデーションを、 $-10\text{ nm} \sim 10\text{ nm}$ の範囲内にすることが好ましい。

【0062】また、本発明の溶液製膜方法で製造されたセルロースアシレートフィルムは、OCBモードの液晶セルを有するOCB型液晶表示装置あるいはHANモードの液晶セルを有するHAN型液晶表示装置の光学補償シートの支持体としても有利に用いられる。OCB型液晶表示装置あるいはHAN型液晶表示装置に用いる光学補償シートには、レターデーションの絶対値が最小となる方向が光学補償シートの面内にも法線方向にも存在しないことが好ましい。OCB型液晶表示装置あるいはHAN型液晶表示装置に用いる光学補償シートの光学的性質も、光学的異方性層の光学的性質、支持体の光学的性質および光学的異方性層と支持体との配置により決定さ\*

#### <ドープの調製>

##### (微粒子分散液の調製)

シリカ(日本アエロジル株式会社製、「アエロジルR972」)	2.00重量%
セルロースアセテート(置換度2.8)	2.00重量%
トリフェニルフォスフェート	0.16重量%
ビスフェニルジフェニルフォスフェート	0.08重量%
メチレンクロライド	88.10重量%

\*れる。

【0063】さらに、本発明の溶液製膜方法により製造されたセルロースアシレートフィルムは、ASM(Axially Symmetric Aligned Microcell)モードの液晶セルを有するASM型液晶表示装置の光学補償シートの支持体としても有利に用いられる。ASMモードの液晶セルは、セルの厚さが位置調整可能な樹脂スペーサーにより維持されているとの特徴がある。その他の性質は、TNモードの液晶セルと同様である。ASMモードの液晶セルとASM型液晶表示装置については、クメ(Kume)外の論文(Kume et al., SID 98 Digest 1089 (1998))に記載がある。セルロースアシレートフィルムを、TNモードの液晶セルを有するTN型液晶表示装置の光学補償シートの支持体として用いてもよい。TNモードの液晶セルとTN型液晶表示装置については、古くから良く知られている。TN型液晶表示装置に用いる光学補償シートについては、特開平3-9325号、同6-148429号、同8-50206号、同9-26572号の各公報に記載されている。

【0064】前記液晶セルの液晶層は、通常は、二枚の基板の間にスペーサーを挟み込んで形成した空間に液晶を封入して形成する。透明電極層は、導電性物質を含む透明な膜として基板上に形成する。液晶セルには、さらにガスバリアー層、ハードコート層あるいは(透明電極層の接着に用いる)アンダーコート層を設けてもよい。これらの層は、通常、基板上に設けられる。液晶セルの基板は、一般に $80 \sim 500\text{ }\mu\text{m}$ の厚さを有する。

【0065】前記偏光素子の偏光膜には、ヨウ素系偏光膜、二色性染料を用いる染料系偏光膜やポリエーテル系偏光膜がある。いずれの偏光膜も、一般にポリビニルアルコール系フィルムを用いて製造する。偏光板の保護膜は、 $25 \sim 350\text{ }\mu\text{m}$ の厚さを有することが好ましく、 $50 \sim 200\text{ }\mu\text{m}$ の厚さを有することがさらに好ましい。液晶表示装置には、表面処理膜を設けてもよい。表面処理膜の機能には、ハードコート、防曇処理、防眩処理および反射防止処理が含まれる。

#### 【0066】

【実施例】本発明による溶液製膜方法の実施例について説明する。図1に示した製膜装置(バンド流延方式)を用い、セルローストリアセテートフィルムを製造した。

#### 【0067】

15

メタノール

なる溶液を調製し、アトライターにて体積平均粒径0.5  $\mu\text{m}$ になるよう分散を行った。ここで体積平均粒径は、堀場製作所製、「粒度分布測定装置 LA920」\*

(原料ドープの調製)

セルロースアセテート(置換度2.8)

トリフェニルフォスフェート

ビフェニルジフェニルフォスフェート

なる固形分100重量部に対し、上記微粒子分散液を6.5重量部添加し、さらに、

ジクロロメタン

メタノール

なる混合溶媒を適宜添加、攪拌溶解し原料ドープを調製した。原料ドープの固形分濃度は18.5重量%であった。この原料ドープを濾紙(東洋濾紙株式会社製、「#63」)にて濾過した後、さらに焼結金属フィルム(日※

(紫外線吸収剤溶液の調製)

2(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-tert-ブチルフェニル-5-クロルベンゾトリアゾール)

2(2'-ヒドロキシ-3', 5'-ジ-tert-アミルフェニル-5-クロルベンゾトリアゾール)

セルロースアセテート(酢化度:60.8%)

トリフェニルフォスフェート

ビフェニルジフェニルフォスフェート

メチレンクロライド

メタノール

【0070】上記処方にて紫外線吸収剤溶液を調製し、富士写真フィルム株式会社製、「アストロボア10  $\mu\text{m}$  フィルタ」にて濾過した。

【0071】(流延ドープの調製)上記原料ドープに対し、スタティックミキサーを用い、上記紫外線吸収剤溶液を、原料ドープ中の固形分に対し紫外線吸収剤量が1.04重量%になるよう調製しつつ、原料ドープの配管経路において添加、混合し、流延ドープを調整した。この流延ドープを図1に示すような製膜装置を用いて流延し、自己支持性を持つまで熱風乾燥し、フィルムとして剥離した。

【0072】流延バンドとしては、ステンレススチールからなり、幅2m、長さ56m(面積112  $\text{m}^2$ )からなるものを用いた。この流延バンドの中心線平均粗さ

(Ra)は、0.002  $\mu\text{m}$ であり、流延バンド厚み差は、0.02mmであった。中心線平均粗さ(Ra)の測定は、JIS B 0601に規定によった。単位は、[ $\mu\text{m}$ ]である。また、バンド1回転分のフィルムの厚

味を巾方向及び流延方向に測定したところ、厚味差は2★

セルローストリアセテート

(置換度2.83、粘度平均重合度320、含水率0.4質量%、メチレンクロライド溶液中6質量%の粘度305  $\text{mPa}\cdot\text{s}$ )

酢酸メチル

シクロペンタン

16

7.66重量%

\*で測定した値を用いた。

【0068】

89.3重量%

7.1重量%

3.6重量%

92重量%

8重量%

※本精線株式会社製、「06N」、公称孔径10  $\mu\text{m}$ で濾過し、さらにメッシュフィルム(日本ボール株式会社製、「RM」、公称孔径45  $\mu\text{m}$ )で濾過した。

【0069】

11.66重量%

1.48重量%

0.12重量%

0.06重量%

74.38重量%

6.47重量%

★ $\mu\text{m}$ 以下であった。

【0073】製膜の条件は以下の通りである。

製膜速度:30m/分

フィルム(ベース)厚み:80  $\mu\text{m}$ 

流延バンド1回転当たりのバンド位置の巾方向変化は2mmであった。

【0074】[実施例2]図1に示した製膜装置(バンド流延方式)を用い、3層構成のセルローストリアセートフィルムを製造した。

【0075】<内層のセルローストリアセートフィルム用ドープの調整>攪拌羽根を有するステンレス性溶解タンクに、下記の溶媒混合溶液によく攪拌しつつ、セルローストリアセート粉体(平均サイズ2mm)を徐々に添加し、仕込んだ。添加後、室温(25℃)にて3時間、25℃にて放置し、セルローストリアセートを膨潤させた。なお、溶媒である酢酸メチルとシクロペンタン、アセトン、メタノール及びエタノールは、すべてその含水率が0.2質量%以下のものを利用した。

20質量部

43質量部

10質量部

17	18
アセトン	5質量部
メタノール	5質量部
エタノール	5質量部
可塑剤A（ジペンタエリスリトールヘキサアセデート）	6質量部
可塑剤B（トリフェニルフォスフェート）	6質量部
微粒子（シリカ（粒径20nm））	0.1質量部
紫外線吸収剤a	0.1質量部
（2，4-ビス-（n-オクチルチオ）-6-（4-ヒドロキシ-3，5-ジ-tert-ブチルアニリノ）-1，3，5-トリアジン）	
紫外線吸収剤b	0.1質量部
（2（2'-ヒドロキシ-3'，5'-ジ-tert-ブチルフェニル）-5-クロロベンゾトリアゾール）	
紫外線吸収剤c	0.1質量部
（2（2'-ヒドロキシ-3'，5'-ジ-tert-アミルフェニル）-5-クロロベンゾトリアゾール	
$C_{12}H_{25}OCH_2CH_2O-P(=O)-(OK)_2$	0.05質量部

【0076】なお、後述する冷却溶解法で得られたこの溶液の粘度は160Pa・S（45℃）であった。

【0077】＜セルローストリアセート溶液の冷却溶解＞上述したセルローストリアセート溶液をスクリー  
ー押し出し機で送液して、-70℃で3分間となるように冷却部分を通させた。冷却は冷凍機で冷却した-80℃の冷媒（3M社製、「フロリナート」）を用いて実施した。次に、冷却により得られた溶液はステンレス製の容器に移送し、50℃で2時間攪拌した。そして、絶対濾過精度0.01mmの濾紙（東洋濾紙（株）製、「#63」）で濾過した。

【0078】＜外層のセルローストリアセートフィルム用ドープの調整＞上述した内層のセルローストリアセートフィルム用ドープにおいて、セルローストリアセートを19質量部、酢酸メチルを44質量部に変更した他は、同様に仕込んだ。なお、冷却溶解法で得られたこの溶液の粘度は110Pa・S（45℃）であった。

【0079】＜セルローストリアセートフィルムの作製＞上述したドープを三層共流延ダイを用い、内層用ドープが内側に、外層用ドープが両外側になるように配置して、流延バンド上に同時に吐出させて重層流延した後、流延膜を流延バンドから剥ぎ取り、乾燥して三層構造のセルローストリアセートフィルム積層体（内層の厚さ：80μm、各表面層の厚さ：2μm）を作製した。流延バンドは、実施例1と同一のものをを使用した。また、流延バンド1回転当たりのバンド位置の巾方向変化は2mmであった。乾燥は70℃で3分、130℃で5分した後、ガラス板からフィルムを剥ぎ取り、そして160℃、30分で段階的に乾燥して溶剤を蒸発させセルローストリアセートフィルムを得た。また、バンド1回転分のフィルムの厚味を巾方向及び流延方向に測定したところ、厚味差は2μm以下であった。

【0080】【外観面状の評価】実施例1、2で製膜さ

れたセルローストリアセートフィルムの平滑性、透明性及び厚み精度を評価したところ、いずれも極めて良好であった。

20 【0081】【偏光板の作成方法および評価方法】偏光板サンプルは、ポリビニルアルコールを延伸してヨウ素を吸着させた偏光素子の両面に、ポリビニルアルコール系接着剤により実施例1、2で製膜されたセルローストリアセートフィルムを貼合作製した。この偏光板サンプルを60℃、90%RHの雰囲気下で500時間暴露した。いずれの実施例においても偏光度は99.6%以上であり、十分な耐久性が認められた。

【0082】なお、偏光度は、分光光度計により可視領域における並行透過率 $Y_p$ 、直行透過率 $Y_c$ を求め、次式に基づき偏光度 $P$ を決定した。

$$P = \sqrt{(Y_p - Y_c) / (Y_p + Y_c)}$$

【0083】

【発明の効果】本発明は、以上のように流延バンドの中心線平均粗さを所定の値以下とすることにより、平滑性及び透明性の良好なフィルムを製造することができる。また、流延バンド厚み差を所定の値以下にすることにより、厚み精度の良好なフィルムを製造することができる。

【図面の簡単な説明】

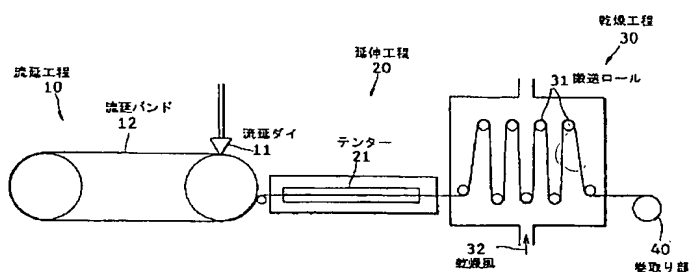
40 【図1】 溶液製膜方法に用いる溶液製膜装置の概略模式図である。

【図2】 流延バンドの部分側面図である。

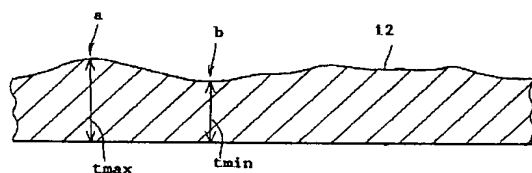
【符号の説明】

10…流延工程  
11…流延ダイ  
12…流延バンド  
20…延伸工程  
30…乾燥工程  
40…巻取り部

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	ターマコード (参考)
B 2 9 L	7:00	B 2 9 L	7:00
	9:00		9:00
C 0 8 L	1:12	C 0 8 L	1:12

(72)発明者 辻本 忠宏  
 神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真  
 フィルム株式会社内

F ターム(参考) 4F071 AA09 AD02 AE04 AE05 AE10  
 AE22 AH12 AH19 BA02 BB02  
 BC01 BC02 BC12  
 4F202 AA01 AB07 AB10 AB11 AB14  
 AC05 AG01 AG03 AH73 AR13  
 CA07 CB02 CB26 CK11  
 4F205 AA01 AB07 AB10 AB11 AB14  
 AC05 AG01 AG03 AH73 AR13  
 GA07 GB02 GB26 GC07 GF02  
 GN28